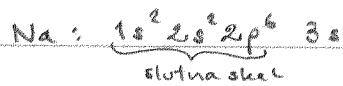


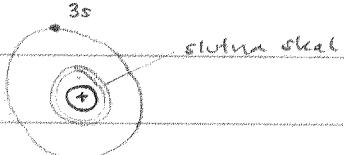
Föreläsning 11.

Fasta tillståndets fysik.

Som exempel på ett fast ämne ska vi välja Na, inte särskilt praktiskt användt, men ett bra ur pedagogisk synpunkt.

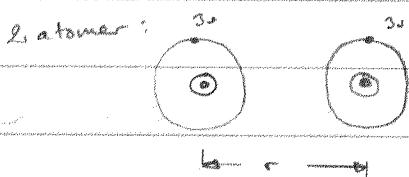


enkel bild av Na-atom:

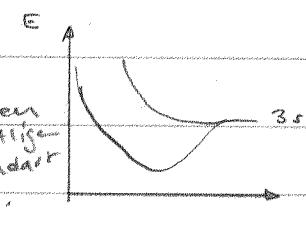


Na-metall innehåller $\approx 10^{28}$ atomer per m^3

Bilda Na-metall i steg:



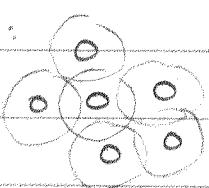
Obs!
Beteckningen
3s är egentligen
högt överdådigt
för att
vara korrekt.



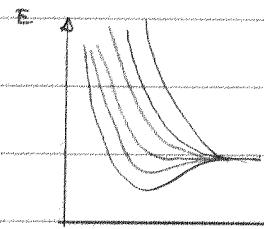
start avstånd inget över-
tapp mellan 3s-värtigheterna
⇒ ingen splitting.

högtillstånd avstånd: överläpp
⇒ splitting av 3s-nivåerna
pga mer kompl. potential
Dock rymmer det låga kraft.
2 elektroner (1s)

6 atomer:

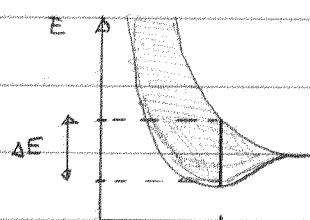


3s-elektronerna
"glömmer" från
vilken atom de
hörsammar.



sex nivåer
De tre nedre är
ochuppliftrade

→ många atomer:



Kvantationsteknologi.

For givet atomavstånd
mellan närmaste grannar
finns det lit. Schröd.
inom ΔE .

Halva detta band är
ochuppliftrat av elektroner,

Den samtalade mängden av 3s-elektroner för sig i en potential
som ges av jönerna.

Tidigare har vi studerat frielectrongasen och man kan teoretiskt
beräkna ett antal fysikaliska egenskaper som en sådan har
säsong E_F , elektrisk och termisk ledningsförmåga, specifikt värme.

En jämförelse med experimentella resultat ger oft en hel rad
metaller går att beskriva med hjälp av frielectronmodellen.

Exempel på detta är: Na, K, Al, Pb ... enkla metaller med
slutna skäl inanför valen-elektronen.

Av de 92 naturliga elementen är 62 metaller och av dessa är 20 ena. De 40 andra är s.k. övergångsmetaller med mer än ett ofyllt skel: ex Fe, W, Ni ...

Metaller karaktäriseras av: god elektrisk och termisk ledn. f.d.m., god導電性, 高反射率, 高機械強度.

I samtliga dessa fall är det förekomsten av färrörliga elektroner som är förklaringen, men vad är orsaken till att det finns

lättförliga elektroner i vissa material och inte i andra?

Detta

Schematisk bild.

$T=0$



Metall

$T \neq 0$

Oversta
bandet
som
är ockuperat

Isolator/halvledare (ingen principiell skillnad mellan dessa)

tomma tillstånd: ledningsband

bandgap = energidistansen där det inte finns några tillåtna tillstånd ($0,1-10\text{ eV}$)

Helt fyllt band: valentband

Lätförlighet hos elektronerna kräver att det finns tomta (tillåtna)

tillstånd infinitesimalt nära de ockuperade tillstånden.

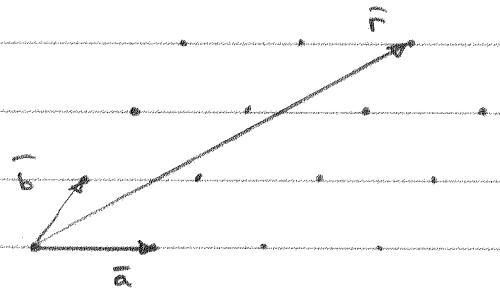
I friktionssmodellen kan inte bandgap finnas. Vissretigen är de tillåtna energinivåerna diskreta, men vid makroskopiska utströmningar (L_x, S, V) är energiavständerna närmestligen tillräckligt mycket liten.

Bandgap kan förklaras med att ta hänsyn till att elektronerna känner av den periodiska potential som jonerne ger upphov till. Atomstrukturen studeras i kristallogravin.

Kristallografi. Kristallstruktur = gitter + bas.

Gitter = en oändlig uppställning punkter arrangerad så att varje punkt har identisk omgivning.

2 dim:



$$\vec{r} = n_1 \vec{a} + n_2 \vec{b}$$

n_1 och n_2 är heltal

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ är basvektorer.

3 dim: $\vec{r} = n_1 \vec{a} + n_2 \vec{b} + n_3 \vec{c}$

Det finns 14 olika sätt att arrangera identiska punkter.

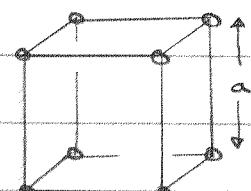
Man tarar om 14 Bravaisgitter.

Kubiska gitter är vanliga och enklast.

Tre typer:

1) enkelt kubiskt gitter
(sc)

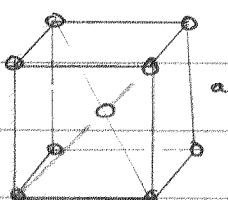
enhetcell



kubkant a = gitterkonstant

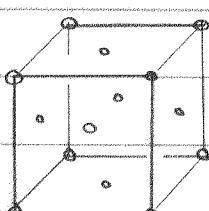
$$8 \cdot \frac{1}{8} = 1 \text{ gitterpunkt i varje enhets-cell}$$

2) ryndcentrerat kubiskt gitter: (bcc)



$$8 \cdot \frac{1}{8} + 1 = 2 \text{ gitterpunkter i varje enhets-cell}$$

3) ytcentrerat kubiskt gitter (fcc)



$$8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4 \text{ gitterpunkter i varje enhets-cell.}$$

Kristallstrukturen får man genom att tillordna varje gitterpunkt en eller flera atomer.

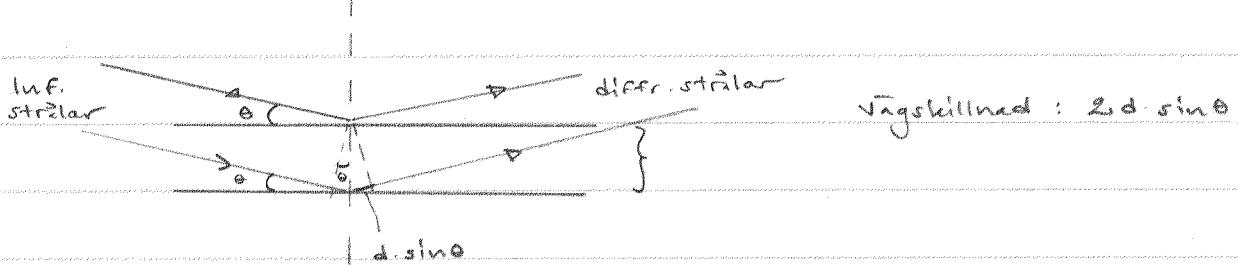
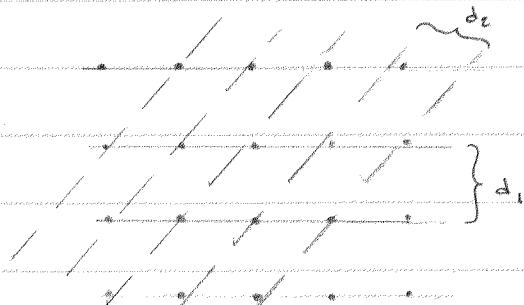
Hur bestämmer man kristallstruktur och gitterkonstanter?

Med diffractionsexperiment. $a \text{ \AA}$ är av storleksordningen 5\AA

Vilket innebär att den diffrakterande vågängen λ ska vara röntgenångående.



Till skillnad från vad vi är vanliga vid från optiken är det diffrakterande provet tredimensionellt. Atomerna sprider den infallande röntgenstrålningen. Man kan uppfatta detta som om provet bestod av ett antal delvis genombrottiga speglar.



$$\text{Vilkor för konstruktiv interferens: } 2d \cdot \sin \theta = n\lambda \quad (\text{Braggs lag})$$

En fiffig metod för att bestämma d för olika planvärden är att definiera planvärdenas Millerindex.

Vi kan skriva om Braggs lag på följande form av skäl som framgår senare

$$2 \frac{d}{n} \cdot \sin \theta = \lambda$$

Millerindex. (hkl)

1) Studera två närliggande plan i planskalan

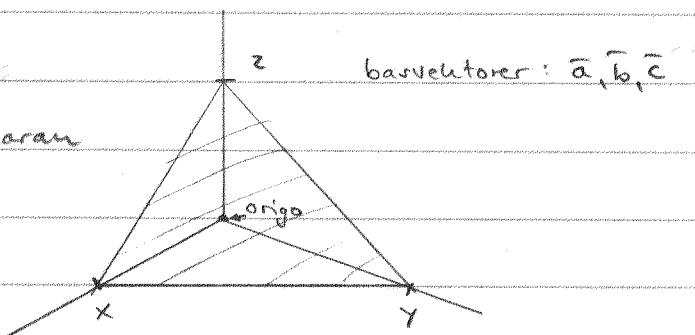
2) Placera origo i det "bakre" planet

3) Bestäm skärningspunkterna x,y,z för det andra planet

4) Bestäm $\frac{x}{a}, \frac{y}{b}, \frac{z}{c}$

5) Invertera: $\frac{a}{x} \frac{b}{y} \frac{c}{z}$

6) Multiplisera med minsta gemensamma nämnare $\Rightarrow h, k, l$ (heltal)

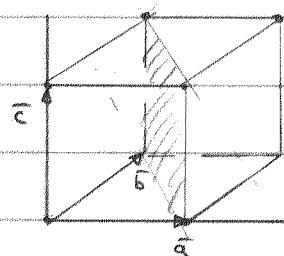


exempel

skärningspunkter 1,1,∞

invertern: 1,1,0

$$\therefore (hkl) = (110)$$



Allt detta kräver ledet till beträffanden (kubiska gitter)

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

d_{hkl} = avståndet mellan närliggande plan i planskalan
med Millerindex (hkl)

I strukturen ovan ser vi att vi betraktar längs -c

(220)

(110)

Det är uppenbart att det inte finns
nägon (220)-planskala eftersom denne inte
går igenom några gitterpunkter. Vi kan
dock bygga in interferens av högre ordning n

i Braggs lag genom att ersätta d med $\frac{d}{n}$

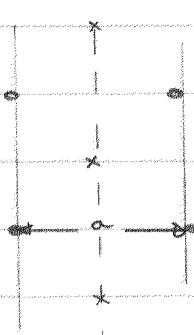
$$2 \cdot d_{110} \cdot \sin\theta = \lambda$$

$$\Rightarrow 2 \cdot \frac{d_{110}}{2} \cdot \sin\theta = \lambda \Rightarrow 2 \cdot d_{220} \cdot \sin\theta = \lambda$$

Om vi tar hänsyn till möjligheten att bygga in interferens av högre ordning i d_{hkl} så är alla kombinationer av hkl tillåtna i en enkel kubisk struktur.

Detta är inte fallet i mer komplicerade strukturer såsom bcc- och fcc-struktur.

bcc sett från ovan:



200-plan

100-plan

Någon planskärta där avståndet
mellan närliggande plan
är så stor som a finns
int. "Centrumatomerna" x
kilar in en planskärta
mitt emellan (100)-planen,

Detta geometriska faktum kan uttryckas med hjälp av den s.k. strukturfaktoren. Denne ger att

bcc: $h+k+l$ måste vara ett jämt tal

fcc: $h+k+l$ måste vara alla udda eller alla jämma.

Nu har vi kunskap för att förstå principerna för hur man experimentellt bestämmer kristallstrukturer med hjälp av diffractionsexperiment. Förutom röntgenstrålning kan man använda elektroner eller neutroner.

(7)

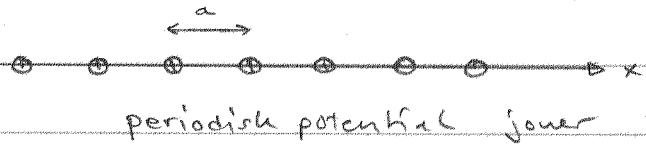
Bandgap.

För att kunna förstå varför vissa ämnen är metaller och andra är isolatorer behöver vi, som vi sagt tidigare, begreppet bandgap.

Det är omöjligt att förstå bandgap, förbjudna energimråden, enbart genom att använda frieliktningsmodellen.

Vi måste ta hänsyn till att elektronerna rör sig i ett rum där potentialen varierar

Endimensionell illustration:



För smä värden på k (dvs stor λ) uppfattar elektronen potentialen som konstant (\approx medelvärdet av potentialen)
 $\Rightarrow E \sim k^2$ (för smä k)

När k ökar (λ minskar) kommer elektronerna att i allt högre utsträckning känna av att potentialen varierar i rummet.

Speciellt markant blir detta för $k = \frac{\pi}{a}$ ($\Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{a} = \frac{2\pi \cdot a}{a} = 2a$)

Elektronerna uppfattar jonerne som spridare.

Allmänt:

$$\Psi(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx}$$

om $k < \frac{\pi}{a}$ sätter vi in $A \gg B$

$$k = \frac{\pi}{a} \Rightarrow \Psi(x) = C \left[e^{i \frac{\pi}{a} x} \pm e^{-i \frac{\pi}{a} x} \right] =$$

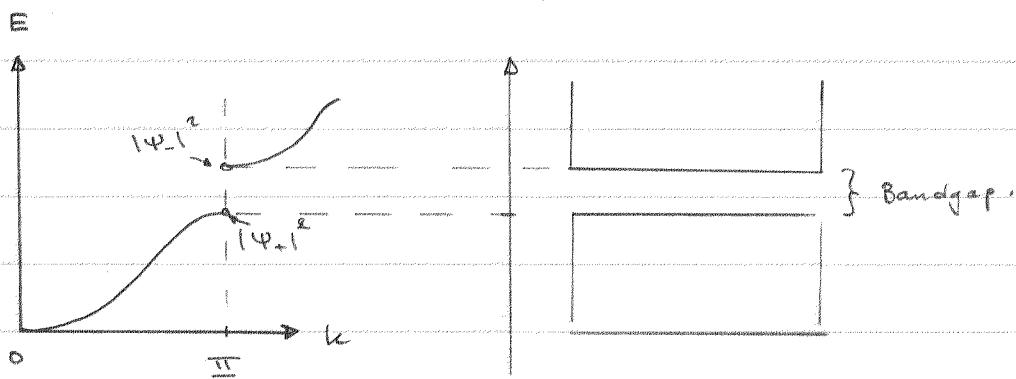
$$= \begin{cases} 2C \cdot \cos \frac{\pi}{a} x & |\Psi|^2 = 4C^2 \cos^2 \frac{\pi}{a} x (+) \\ 2C \cdot \sin \frac{\pi}{a} x & \text{elektron-} \\ & \text{tätheten} \\ & 4C^2 \cdot \sin^2 \frac{\pi}{a} x (-) \end{cases}$$



$|\Psi_+|^2$: elektronerna och ionerna nära varandra
i medeltal \Rightarrow lägre potentiell energi

$|\Psi_-|^2$: elektronerna ligger i medeltal långt ifrån
ionerna \Rightarrow högre potentiell energi.

I båda fallen är $k = \frac{\pi}{a}$ van kinetiska energin summa.



För att bestämma sambandet mellan E och k (dispersionrelationen)
i området mellan små k och $k = \frac{\pi}{a}$ krävs detaljerad löning
av schrödingerlåtionsen (periodisk potential)

Vad händer då elektronen utsätts för ett ytterpålagt elektriskt
fält \vec{E} ? Man kan visa att:

$$(\vec{F} = -e\vec{E})$$

$$a = \frac{F}{t^2} = \frac{F}{\frac{d^2E}{dk^2}} = \frac{F}{m^*}$$

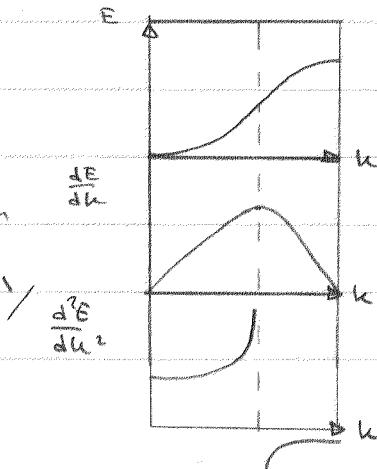
m^* kallas effektiva bandmassan.

$$\text{ex. } E = \frac{\hbar^2}{2m} k^2 \Rightarrow \frac{d^2E}{dk^2} = \frac{\hbar^2}{m} \Rightarrow m^* = m$$

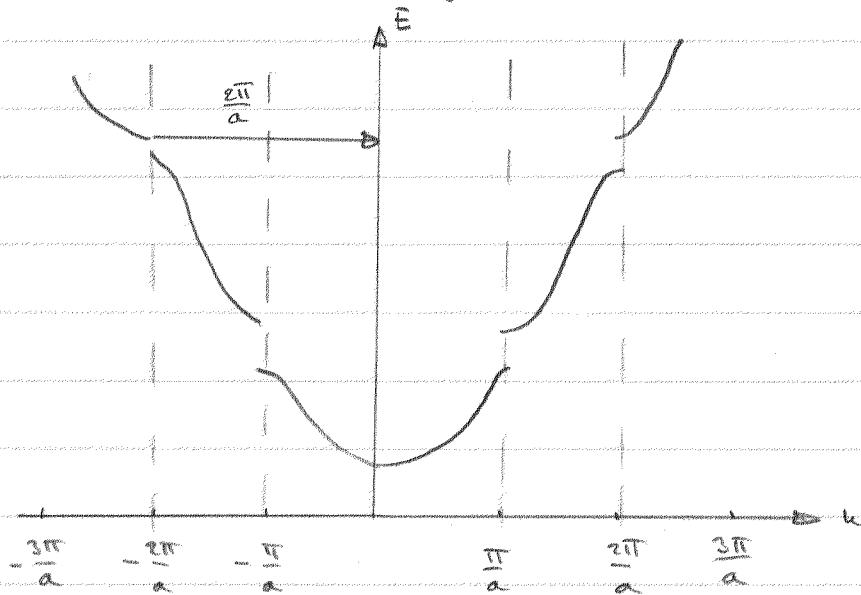
för $E \propto k^2$ får vi $m^* = \text{konstant}$

om prop. konst $\approx \frac{\hbar^2}{2m}$ för vi $m = m$
I annat fall annat värde på m^* .

Notera förekomsten av
negativ effektiv massa.



En lösning av Schrödinger-ekvationen kan ge följande resultat:

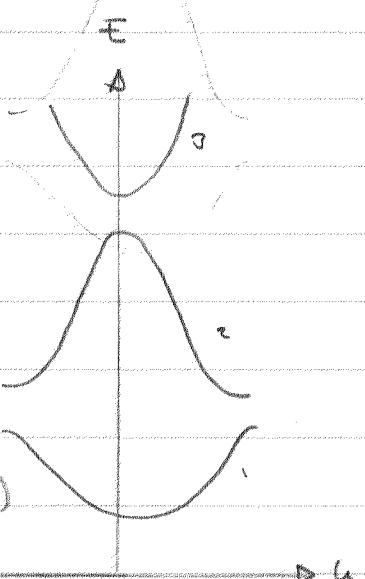


Det är inte den vanliga impulsen (som för fria partiklar) utan kallas kristallimpulsen. Man kan visa att denne måste bevaras särskilt om på $\pm \frac{n\pi}{a}$ vid övergång från ett band till ett annat.

Därför är det praktiskt att rita om figuren ovan enligt

Vare band har plats
för 2 elektroner

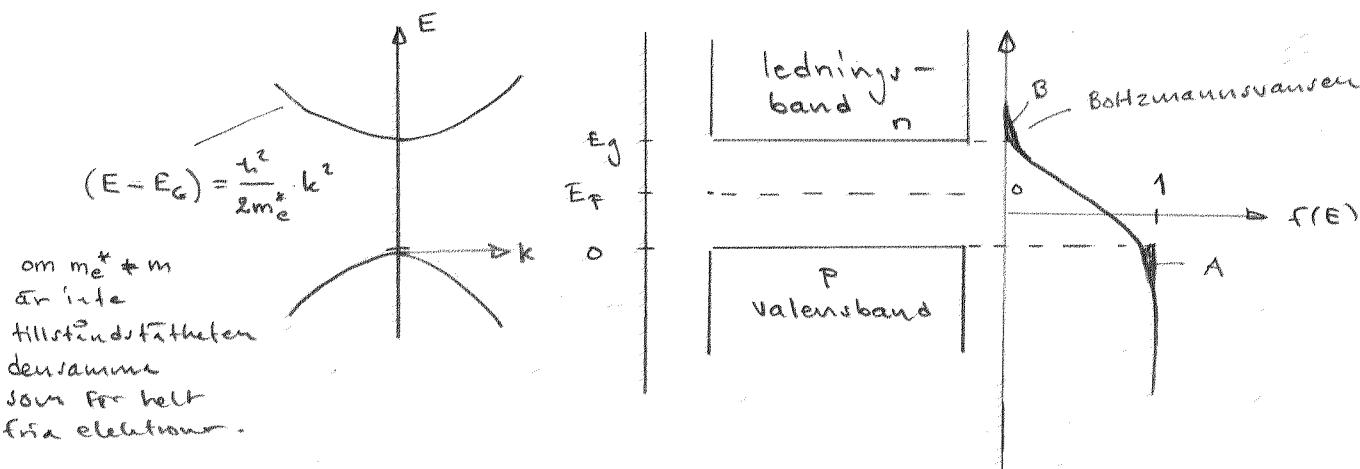
Udda antal valenselektroner
ger halufyllda band (metall)
medan jämnt antal ger
helfyllda band (isolator/halvled.)



Låt oss undersöka halvledaren Si närmare.

Si har fyra valenselektroner och fyller vid $T=0$ de två understa banden helt, dvs. $E_a = E_b$. Då är det i detta mättet en isolator.

Elektron- och holtäthet för halvledare.



A

n = antal elektroner (fria) per volymsenhet i ledningsbandet

p = antalet hål per volymsenhet i valensbandet

$$\text{fria elektroner : } D(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} \cdot E^{1/2}$$

$(h$ i stället för \hbar !)

Beräkna n !

$$n = \frac{N_{tot}}{V} = \frac{1}{V} \int_{E_g}^{\infty} (\text{Tillståndstättheten i ledn. bandet}) \left(\begin{array}{l} \text{fri, flik, värde 1} \\ \text{ledn. bander} \end{array} \right) \cdot dE$$

$$= \frac{1}{V} \int_{E_g}^{\infty} \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e^*}{h^2} \right)^{3/2} \cdot (E - E_g)^{1/2} \cdot \frac{1}{e^{(E - E_F)/kT} + 1} \cdot dE$$

B

För en ren halvledare (odopad) gäller att varje elektron i ledningsbandet har lämnat ett hål efter sig i valensbandet. Pga fördelningsfunktionens symmetri runt E_F (se fig till höger längst upp på denne sida) måste E_F ligga ungefärligt i mitten av bandgaper om tillståndstättheten för elektroner och hål inte skiljer sig drastiskt.

$$\because E - E_F \approx 0,5 \text{ eV} \quad kT \approx 1/40 \text{ eV om } T = 700 \text{ K}$$

$$\Rightarrow \frac{(E - E_F)/kT}{e} \gg 1$$

$$\Rightarrow f(E) \approx e^{-\frac{(E - E_F)/kT}{e}}$$

$$\Rightarrow n = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e^*}{h^2} \right)^{3/2} \int_{E_g}^{\infty} (E - E_g)^{1/2} e^{-\frac{(E - E_F)/kT}{e}}$$

Vi vet naturligtvis att inte ledningsbandet sträcker sig till $E = \infty$, men tack vare att exponentialfunktionen snabbt går mot noll för stora E , så har bidrag med stor energi viut noll.

$$e^{-(E-E_F)/kT} = e^{-(E-E_g)/kT} \cdot e^{(E_g-E_F)/kT} \quad (2)$$

Eg och E_F konst.

$$\Rightarrow n = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e^*}{h^2} \right)^{3/2} e^{(E_g-E_F)/kT} \cdot (kT)^{1/2} \int_{E_g}^{\infty} \left(\frac{E-E_g}{kT} \right)^{1/2} e^{(E-E_g)/kT} dE$$

$$x = \frac{E-E_g}{kT} \Rightarrow dx = \frac{dE}{kT} \Rightarrow dE = dx \cdot kT$$

$$E = E_g \Rightarrow x = 0$$

$$\int_0^{\infty} x^{1/2} \cdot e^{-x} \cdot dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\Rightarrow n = e \left(\frac{m_e^* \cdot kT}{2\pi h^2} \right)^{3/2} e^{(E_F-E_g)/kT} = n_0 e^{(E_F-E_g)/kT}$$

n_0 beror av värdet på T och m_e^* men om $T = 300 \text{ K}$ och $m_e^* = m = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ så gäller

$$n_0 = e \left(\frac{9,11 \cdot 10^{-31}, 1,38 \cdot 10^{-23}, 300}{2\pi \cdot (1,05 \cdot 10^{-34})^2} \right)^{3/2} = 2,5 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

ex. s.l. $E_g = 1,1 \text{ eV}$ $E_F = E_g/e = 0,55 \text{ eV}$
 $T = 300 \text{ K}$ $\Rightarrow kT = 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300 \text{ J} =$

$$= \frac{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}{1,6 \cdot 10^{-19}} \text{ eV} = 0,0259 \text{ eV}$$

$$\Rightarrow n = 2,5 \cdot 10^{25} \cdot e^{-0,55/0,0259} = 1,467 \cdot 10^{16} \approx 1,5 \cdot 10^{16}$$

Si har 10^{28} atomer/m³

∴ vid 300 K har en Si-atom på 10^{12} lämnat ifrån sig en elektron till ledningsbandet.

(3)

Beräkna p!

$$-|E| = \frac{h^2}{2m_n^* k^2}$$

Nu gäller det att summa över alla tomma tillstånd i valensbandet.

Tillståndsdichten i valensbandet.

$$D(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m_n^*}{h^2} \right)^{3/2} |E|^{1/2}$$

Sannolikheten för att ett tillstånd är tomt =

$$= 1 - (\text{sannolikheten för besatt tillstånd})$$

$$\Rightarrow f_{\text{tömt}}(E) = 1 - f(E) = 1 - \frac{1}{e^{(E-E_F)/kT} + 1}$$

Nu gäller $E - E_F \approx 0$ och $e^{(E-E_F)/kT} \ll 1$

$$1 - \frac{1}{e^x + 1} = \frac{e^x + 1 - 1}{e^x + 1} \approx e^x$$

$$\Rightarrow f_{\text{tömt}}(E) = e^{(E-E_F)/kT}$$

$$\Rightarrow P = \frac{1}{V} \int_{-\infty}^0 D(E) \cdot f_{\text{tömt}}(E) \cdot dE = \\ = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_n^*}{h^2} \right)^{3/2} \int_{-\infty}^0 -E^{1/2} e^{(E-E_F)/kT} \cdot dE \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P = 2 \left(\frac{m_n^* k T}{2\pi h^2} \right)^{3/2} e^{-E_F/kT} =$$

$$= 1,5 \cdot 10^{25} \cdot e^{-E_F/kT}$$

Rent si: $E_F - E_g = -E_F$ eftersom $E_F = E_g/2$

$P = n$ gäller för rent si (om se)

4

$$\text{Ge: } E_g = 0,7 \text{ eV} \Rightarrow E_F = 0,35 \text{ eV}$$

$$\Rightarrow n = p = 2,5 \cdot 10^{25} \cdot e^{-0,35/0,0259} = \\ = 3,4 \cdot 10^{11} \text{ m}^{-3}$$

Om vi dopar halvledaren (n-doping el. p-doping) blir n:an p och vice versa.

I våra uttryck ovan för n och p innebär detta att E_F ändras, men allt annat är oförändrat.

Notera speciellt:

$$n \cdot p = n_0 \cdot e^{(E_F - E_g)/kT} \cdot p_0 \cdot e^{-E_F} = \\ = n_0 \cdot p_0 \cdot e^{-E_g/kT} = \text{konstant}.$$

Om vi dopar så att antalet elektroner i ledningsbandet ökar så kommer antalet håll i valensbandet att minskha,

Extra övningsexempel i halvledarfysik.

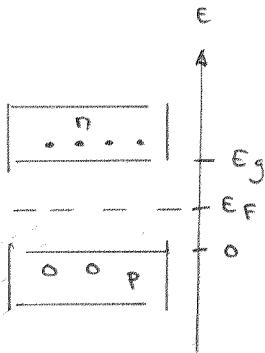
1. En halvledares elektriska ledningsförmåga beror bl a av dopning och mobilitet för elektroner och hål. Eftersom mobiliteten elektroner och hål i regel inte är lika stora har den elektriska ledningsförmågan ofta inte minimum när halvledaren är odopad. Hur stor är den minsta ledningsförmågan för Si vid rumstemperatur? Hur stora är hål-respektive elektronkoncentrationen? $\mu_e = 0,16 \text{ m}^2/\text{Vs}$, $\mu_h = 0,04 \text{ m}^2/\text{Vs}$.
2. Ett Si-prov är dopat med ett störämne vars jonisationsenergi är mycket låg. Vid 300 K är elektrontätheten i ledningsbandet 2,0 gånger högre än vad den skulle ha varit om provet hade varit helt rent. Bestäm dopämneskoncentrationen.
3. 100 g Si dopas med 4 mikrogram Al. Jonisationsenergin för Al-atomerna i Si kan sättas till 0,01 eV. Vilken konduktivitet får provet om temperaturen är 300 K. $\mu_e = 0,16 \text{ m}^2/\text{Vs}$, $\mu_h = 0,04 \text{ m}^2/\text{Vs}$.
4. En viss halvledare är acceptordopad till en koncentration $N_A = 1 \cdot 10^{23}/\text{m}^3$. Om vi sätter $E = 0$ i toppen av valensbandet gäller att botten på ledningsbandet E_g har energin 20 kT medan acceptornivån E_A ligger vid $E_g/5$. Vid den temperatur som är aktuell gäller att ferminivån är 5 kT . Effektiva massorna för elektronerna i ledningsbandet och hålen i valensbandet är 12% respektive 100% av den vanliga elektronmassan.

Bestäm

- a. koncentrationen av joniserade acceptorer.
- b. kvoten mellan hål- och elektronkoncentration.
- c. elektronkoncentrationen i ledningsbandet.
- d. bandgapets storlek i eV.

5. Konduktiviteten hos ett Ge-prov mäts vid rumstemperatur. Därefter smälts provet och arsenik tillsätts i en mängd av en föroreningsatom per en miljon Ge-atomer. Den nya kristallen är av n-typ och har en konduktivitet av $1000 (\Omega\text{m})^{-1}$. Mobiliteten för hål och elektroner ges av $\mu_e = 0,45 \text{ m}^2/\text{Vs}$, $\mu_h = 0,35 \text{ m}^2/\text{Vs}$. Hur mycket var den ursprungliga kristallen dopad och hur stor var dess konduktivitet?

Viktiga samband



$$\sigma = n e \mu_e + p e \mu_h$$

$$n = 2,5 \cdot 10^{25} \left(\frac{m^*}{m} \frac{T}{300} \right)^{3/2} e^{-(E_g - E_F)/kT}$$

$$p = 2,5 \cdot 10^{25} \left(\frac{m^*}{m} \frac{T}{300} \right)^{3/2} e^{-E_F/kT}$$

om $m^* = m$, $m_h^* = m$ och $T = 300\text{ K}$ förenklas detta till

$$n = 2,5 \cdot 10^{25} \cdot e^{-(E_g - E_F)/kT} \quad p = 2,5 \cdot 10^{25} \cdot e^{-E_F/kT}$$

samtliga dessa samband gäller såväl intrinsiska (renar) halvledare som extrinsiska (dopade) halvledare.

För intrinsiska halvledare gäller $n = p$

$$\Rightarrow E_F = \frac{E_g}{2} + \frac{3}{4} kT \ln \left(\frac{m_h^*}{m_e^*} \right) \quad \text{med } m_h^* = m_e^* ; E_F = \frac{E_g}{2}$$

$n \cdot p = \text{konstant}$ (massverkan lag)

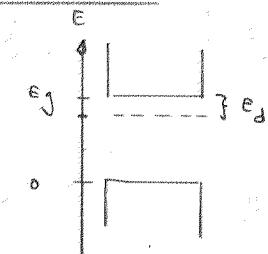
Bra att veta: atomfördelning i fasta ämnen $\approx 10^{28} \text{ m}^{-3}$

$$T=300\text{K} \text{ Si: } n_i = 1,5 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3} = p_i$$

$$T=300\text{K} \text{ Ge: } n_i = 3,4 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3} = p_i$$

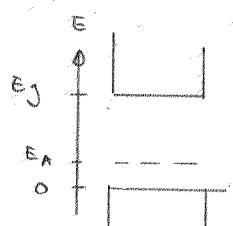
Andelen ioniseringe donatorer:

$$N_d^+ = N_d \left(1 - \frac{1}{e^{[(E_g - E_d) - E_F]/kT}} \right)$$



Andelen ioniseringe acceptorer:

$$N_a^- = N_a \frac{1}{e^{+(E_A - E_F)/kT} + 1}$$



Om det allmänna fallet bestämmer man E_F med hjälp av sambanden:

$$n + N_d^+ = p + N_a^- \quad \text{Materialet är elektriskt (netto) oladat.}$$

Denna ekvation innehåller en enda okänd: E_F

Extra 1. Minimata ledningsförmåga för Si (dopat).
vid T = 300 K.

$$(1) \quad \sigma = n_e p_e + p_h p_p \text{ finn dess minimum!}$$

$$n_i = 1,5 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3} = p_i \Rightarrow n_i \cdot p_i = n_i^2$$

om vi dopar Si kommer produkten av n och p att vara konstant (eftersom T är konstant)

$$\therefore n \cdot p = n_i^2 = 2,25 \cdot 10^{32} \text{ m}^{-6}$$

$$\Rightarrow n = \frac{n_i^2}{p}$$

$$\text{sätt in i (1): } \sigma = e \left(p_e \frac{n_i^2}{p} + p_h \cdot p \right)$$

vid vilken dopning är σ minimal? studera $\frac{d\sigma}{dp}$

$$\frac{d\sigma}{dp} = e \left[-p_e \frac{n_i^2}{p^2} + p_h \right]$$

$$\frac{d\sigma}{dp} = 0 \Rightarrow p = \frac{p_e \cdot n_i^2}{p_h} \Rightarrow p = \sqrt{\frac{0,16 \cdot 2,25 \cdot 10^{32}}{0,04}} \text{ m}^{-3} = \underline{\underline{3 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}}}$$

$$n = \frac{n_i^2}{p} = \frac{2,25 \cdot 10^{32}}{3 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}} = \underline{\underline{0,75 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}}}$$

$$\sigma_{\min} = 1,6 \cdot 10^{-19} \left(0,16 \cdot 0,75 \cdot 10^{16} + 0,04 \cdot 3 \cdot 10^{16} \right) = \\ = \underline{\underline{3,8 \cdot 10^{-4} (\Omega \text{m})^{-1}}}$$

$$\sigma_i = 1,6 \cdot 10^{-19} \left(0,16 \cdot 1,5 \cdot 10^{16} + 0,04 \cdot 1,5 \cdot 10^{16} \right) = \\ = \underline{\underline{4,8 \cdot 10^{-4} (\Omega \text{m})^{-1}}}$$

Eftersom halen är mindre färtigartiga än elektronerna blir σ minimal om vi dopar si så att vi får till fler hål än elektroner.

Extra 2.Bestäm dopningsgraden om $n = 2n_i$!

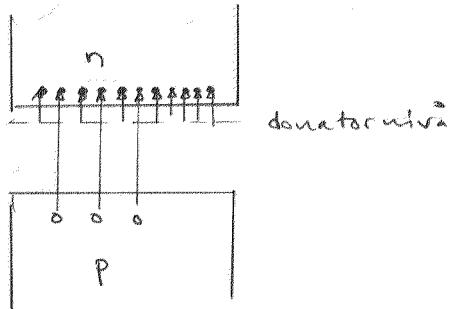
$$\text{Si: } n_i = 1,5 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3} \Rightarrow n^2 = 2,25 \cdot 10^{32} \text{ m}^{-6}$$

$$n = 2n_i = 3 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3} \Rightarrow p = 0,75 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}$$

Im:

Vi har alltså $0,75 \cdot 10^{16}$ häl i valensbandet!

Det betyder att $0,75 \cdot 10^{16}$ är de elektroner som befinner sig i ledningsbandet är intrinsiska.



Sammanlagt har vi $3 \cdot 10^{16}$ elektroner i ledningsbandet.

$3 \cdot 10^{16} - 0,75 \cdot 10^{16} = 2,25 \cdot 10^{16}$ stycken kommer ifrån ioniserade donatorer. Vi har elektronöverskott i donator-doping.

I problemtexten sägs det att 'ionisationsenergin är mycket låg', vilket betyder att vi kan anta att samtliga donatorer är ioniserade.

∴ Dopningsgraden är $2,25 \cdot 10^{16}$ donatorer per m^3 .

Extra 3.Bestäm σ för Al-dopat Si!

$$\text{Si: atomvikt } 28\text{u} = 28 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \Rightarrow \text{Si atantäthet} = \frac{2,73 \cdot 10^3}{28 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27}} = \\ \text{täthet } g = 2,73 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{Al: atomvikt } 27\text{u} = 27 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \Rightarrow \text{Al atantäthet} = \frac{2,70 \cdot 10^3}{27 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27}} = \\ \text{täthet } g = 2,70 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{Dopannestäthet} = \frac{1,4 \cdot 10^{-9} \cdot 5,98 \cdot 10^{28}}{2,70 \cdot 10^3} \cdot \frac{2,73 \cdot 10^3}{100 \cdot 10^{-3}} = 2,06 \cdot 10^{-9} \text{ m}^{-3} = 5,98 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

$$T = 300 \text{ K} \Rightarrow kT = 1,60 \text{ eV}$$

$$E_{\text{jon}} = 0,01 \text{ eV}$$

Vi kan nu räkna ut hur stor andel av Al-atomerna som kommer att vara ioniserade. Om vi gör det finner vi att så gott som samtliga är det. ∴ $n_A^- = n_A = P$

$$n \cdot p = 2,25 \cdot 10^{32}$$

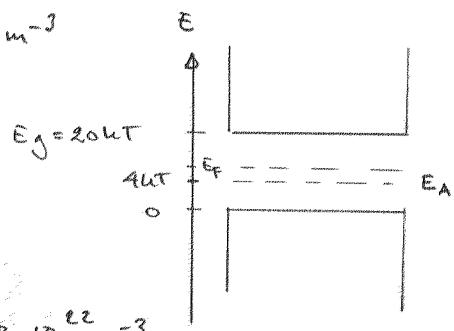
$$p = 2,06 \cdot 10^{21} \Rightarrow n \approx 1 \cdot 10^{11} \text{ formlorar}$$

$$\sigma = \sigma_n = p e \rho_h = 2,06 \cdot 10^{21} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,04 = \\ = 13,8 (\Omega \text{m})^{-1}$$

Extra 4.

$$E_A = 4 \text{ eV} \quad N_A = 1 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$$

$$E_F = 5 \text{ eV}$$



a) $N_A^- = N_A \cdot f(E_A) = N_A \frac{1}{e^{(E_A - E_F)/kT + 1}} =$

$$= N_A \frac{1}{e^{(4kT - 5kT)/kT + 1}} = 1 \cdot 10^{22} \frac{1}{e^{-1} + 1} = 7,3 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$$

b) $n = 2,5 \cdot 10^{25} \left(\frac{m_e^* T}{m \cdot 300} \right)^{3/2} e^{-(E_g - E_F)/kT}$

$$p = 2,5 \cdot 10^{25} \left(\frac{m_h^* T}{m \cdot 300} \right)^{3/2} e^{-E_F/kT}$$

$$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{p}{n} = \left(\frac{m_h^*}{m e^*} \right)^{3/2} \frac{e^{-E_F/kT}}{e^{-(E_g - E_F)/kT}} =$$

$$= \left(\frac{100}{12} \right)^{3/2} \frac{e^{-5}}{e^{-(20-5)}} = \left(\frac{100}{12} \right)^{3/2} \cdot e^{10} =$$

$$= 5,7 \cdot 10^5$$

c)

$$n = \frac{p}{5,7 \cdot 10^5} \approx \frac{N_A^-}{5,7 \cdot 10^5} = \frac{7,3 \cdot 10^{22}}{5,7 \cdot 10^5} \text{ m}^{-3} = 1,28 \cdot 10^{17} \text{ m}^{-3}$$

d)

$$p = 2,5 \cdot 10^{25} \left(\frac{m_h^* T}{m \cdot 300} \right)^{3/2} e^{-E_F/kT} =$$

$$= 2,5 \cdot 10^{25} \left(1 \cdot \frac{T}{300} \right)^{3/2} \cdot e^{-5} = N_A^- = 7,3 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{T}{300} \right)^{3/2} = \frac{7,3 \cdot 10^{22}}{2,5 \cdot 10^{25} \cdot e^{-5}} \Rightarrow T = 172 \text{ K}$$

$$E_g = 20 \text{ meV} = 20 \frac{1,138 \cdot 10^{-23} \cdot 172}{1,6 \cdot 10^{-19}} \text{ eV} = 0,296 \text{ eV} = 0,3 \text{ eV}$$

Extr 5.

Ge

$$\rho_{\text{Ge}} = 5,32 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \quad m_{\text{Ge}} = 78,59 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\Rightarrow \text{atomtätheten i Ge} = \frac{5,32 \cdot 10^3}{78,59 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27}} = 4,41 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$$

Angiven dopningsgrad $1:10^6$

$$\Rightarrow \text{dopåmneskoncentrationen} = 4,41 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$$

As är en donator i Ge där vi n-dopar med As.

$$n = n_e p_e \Rightarrow n = \frac{\sigma}{e p_e} = \frac{100}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,45} = 1,39 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$$

Trots att vi har en As-koncentration på $4,41 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$ blir elektronkoncentrationen "bara" $1,39 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$.

Orsaken till detta är att det ursprungliga provet var p-dopat och dopåmneskoncentrationen var

$$p = (4,41 - 1,39) \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3} = \underline{\underline{3,02 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}}}$$